Int. Cl.: Deutsche KI: 48 b. 17/00 **(2**) 67 a, 31/30 Offenlegungsschrift 2008 664 (1) Aktenzeichen: P 20 08 664.0 21) 2 Anmeldetag: 25. Februar 1970 **43** Offenlegungstag: 9. September 1971 Ausstellungspriorität: Best Available Copy Unionspriorität 3 Datum:

Best Available Copy

Datum:

Land:
Aktenzeichen:

Bezeichnung:
Verfahren zur Politur von metallischen Werkstückoberflächen

Susatz zu:
Ausscheidung aus:
Anmelder:
Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, 6000 Frankfurt

Vertreter:

Benachrichtigung gemäß Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 d. Ges. v. 4, 9, 1967 (BGBl. I S. 960);

Jostan, Josef, Dipl.-Chem. Dr.; Mussinger, Walter; 7900 Ulm

T 200866

1

Als Erfinder benannt:

LICENTIA Patent-Verwaltungs-GmbH 5000 Frankfurt (Main) 70, Theodor-Stern-Kai 1

Ulm (Donau), i1. Febr. 1970 PT-UL/Fg/mj UL 69/232

"Verfahren zur Politur von metallischen Werkstückoberflächen"

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Politur von Metalloberflächen unter Zuhilfenahme der stromlosen und/oder eiektrolytischen Metallabscheidung.

Durch Politur erzeugte, ebene und glänzende Metalloberflächen werden nicht nur für dekorative Zwecke, sondern auch
in vielfältigem Maße für technische Zwecke in der optischen,
elektrotechnischen und Maschinenbau-Industrie benötigt. Beispielsweise verwendet man zur Herstellung dünner Magnetspeichorschichten in der elektronischen Industrie extrem ebene
und glatte Kupferplatten als Schichtträger. Nach dem Stand

der Technik kennt man zur Verringerung der Oberflächenrauhigkeit metallischer Werkstücke zwei Gruppen von Verfahren, nämlich Materialabtragverfahren und Materialaufbauverfahren. Zu den Abtragverfahren zählen die mechanische und chemische Politurimit Hilfe von Poliermitteln oder Polierlösungen, die anodische elektrolytische Politur und die kombinierte anodisch-mechanische Politur, die eine Mombination der zuerst genannten Verfahren darstellt. Zu den Aufbauverfahren rechnet man die kathodische galvanische Abscheidung von metallischen Oberflächenschichten auf dem - Werkstück mit Hilfe einebnender galvanischer Bäder und die Einebnung von Oberflächenrauhigkeit durch Beschichten dos Werkstücks beispielsweise mit Zinn und nachfolgendem Aufschmelzen dieser Oberflächenschicht, so daß während des Schmelzvorgangs das schuelzende Zinn in Oberflächenvertiefungen fließt und dort erstarrt. Mit Hilfe der vorstehend genannten Methoden kann man je nach Ausgangszustand Material und Art des Werkstücks, apparativem und zeitlichem Aufwand zu mehr oder weniger qualitativ hochwertigen Oberflächen gelangen. Oftmals ist es außerdem zweckmäßig, verschiedene Methoden nacheinander anzuwenden, um auf diese Weise zu Endreuhigkeiten (0,1 jum zu kommen, Letzteres ist nach heutigem Stand der Technik fast ausschließlich dann der Fall, wenn das Werkstück mit einer korrosionshermenden

Schutzschicht versehen werden soll. In solchen Fällen wird das Werkstück beispielsweise vor oder nach dem Vergolden regelmäßig poliert.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Erzeugung metallischer Oberflächen mit sehr geringer Endrauhigkeit, das also hauptsächlich zur Verringerung der Mikrorauhigkeit einer Metalloberfläche eingesetzt werden kann.

Die Erfindung besteht darin, daß gleichzeitig mit einem mechanischen Poliervorgang auf den Werkstückoberflächen Metall abgeschieden wird.

Das Verfahren bedient sich also einer Kombination von mechanischen Abtragverfahren und chemischen oder elektrochemischen Aufbauverfahren und stellt eine rationelle und effektvolle Verbesserung der bekannten Verfahren dar. Das Prinzip dieses Verfahrens, das im folgenden kurz "Abscheidungspolitur" genannt werden soll, läßt sich am besten anhand eines schematisch in Fig. 1 dargestellten Oberflächenprofils eines Werkstücks aufzeigen. Bearbeitet man diese Oberfläche eines Werkstücks durch herkömmliche mechanische oder elektrochemische Politur, so werden hauptsächlich die

Spitzen und sonstige Erhöhungen abgetragen, da an diesen geometrisch und energetisch bevorzugten Stellen der mechanische oder elektrochemische Angriff zuerst einsetzt. Die Vertiefung, wie Poren oder Rillen, werden davon zunächst kaum beeinflußt. Beim Einebnen nach herkömmlichen Aufbauverfahren, beispielsweise durch galvanische Metallabscheidung, wird durch entsprechende Badzusätze, sogenannte Inhibitoren, die Abscheidung an den Mikroerhöhungen stärker verzögert als in den Mikrotälern, was auf die unterschiedliche Nachlieferung der Zusatzteilchen an die verschiedenen Stellen des Mikroprofils zurückzuführen ist. Dieser Effekt führt dann zur allmählichen Verflachung und Einebnung der Oberfläche des Werkstücks.

Das erfindungsgemäße Verfahren des "Abscheidungspolierens" bedient sich beider Effekte, nämlich des Abtragens der Miroerhöhungen durch mechanische Vorgänge und des gleichzeitigen Auffüllens der Mikrotäler durch eine stromlose, chemische Metallabscheidung oder elektrolytische Metallabscheidung vorwiegend in diesen Mikrovertiefungen. Um diese beiden Effekte zu erzielen, wird einem stromlos oder elektrolytisch arbeitenden Bad ein Poliermittel zugesetzt und das Werkstück mit dieser Suspension behandelt. Beim elektrolytischen "Abscheidungspolieren" wird dabei das Werkstück als

Kathode geschaltet. Beim erfindungsgemäßen "Abscheidungspolieren" verhindert oder verzögert also der mechanische
Vorgang das Weiterwachsen der Mikroerhöhungen, während
das Zuwachsen der Mikrovertiefungen nicht beeinflußt wird.

Eine Variante dieses Verfahrens besteht darin, daß vor oder bei der Anwendung eines stromlos arbeitenden Bades eine Katalysatorlösung der Poliermittelsuspension zugesetzt wird und diese so veränderte Suspension auf das Werkstück einwirkt. Die Katalysatorlösung kann beispielsweise Palladiumchlorid enthalten, so daß sich auf der Werkstückoberfläche Palladiumkeime bilden, die die stromlose Metallabscheidung katalysieren. Das erfindungsgemäße Verfahren beschränkt sich nicht nur auf die gleichzeitige Anwendung von Poliermittel und stromlosem oder elektrolytischem Bad zur Metallabscheidung, wobei das Poliermittel im Bad suspendiert ist. Vielmehr kann das Poliermittel als Suspension getrennt vom Bad einer Poliermaschine zugeführt werden, so daß es möglich ist, den Poliermittelanteil zu steuern. Auf diese Weise ist es möglich, durch allmähliches Reduzieren des ersten Poliermittels ein zweites, feinkörnigeres dem Wirkmedium zuzuführen oder den Poliermittelanteil mehr und mehr auszuschalten, so daß am Ende des Bearbeitungsprozesses nur noch Hetall auf dem Werkstück nie-

- 6 -

trag mehr erfolgt. Die zuletzt genannte Methode kann beispielsweise dann zweckmäßig angewandt werden, wenn das Werkstück nach der Politur mit einer korrosionshermenden Schutzschicht, z. B. aus Gold, beschichtet werden soll und die Werkstückoberfläche bereits seine gewünschte Güte erreicht hat. Als Poliermittel können bei dem erfindungsgemäßen Verfahren handelsübliche Metalloxide, -carbonate, silicate, Diamantpulver und andere als Rijermittel übliche Stoffe in geeigneten Trägern bzw. Dispergiermitteln verwendet werden. Als solche Dispergiermittel können beispielsweise stromlos arbeitende Kupfer-, Nickel-, Goldbäder oder entsprechende galvanische Bäder dienen. In den folgenden Beispielen wird das erfindungsgemäße Verfahren näher erläutert.

Beispiel 1

Eine Kupferplatte des Formats 60 x 50 mm² und einer Dicke von 2 mm soll als Substrat für dünne Permalloyspeicherschichten dienen und deshalb einseitig auf eine Endrauhigkeit von $\langle 0,02 \rangle$ um poliert werden. Diese Platte rotiont im Gegensinn auf einem Polierteller, der sich ebenfalls dreht und mit einem weichen Wolltuch bespannt ist. Auf den

Polierteller wird laufend eine Suspension von Aluminiumoxid mit einer Korngröße < 0,5 um und einem handelsüblichen, bei Raumtemperatur stromlos arbeitenden Kupferbad getropft, Das Gewichtsverhältnis von Poliersubstanz zu Kupferbad beträgt 1: 50. Nach einer "Abscheidungspolitur" von 10 min war die Oberflächenrauhigkeit der Kupferplatte von anfangs 0,1 um auf die geforderte Endrauhigkeit von 0,01 - 0,02 pm verringert. Das Oberflächenprofildiagramm dieser Kupferplatte ist in Fig. 2 - 3 dargestellt. Fig. 2 gibt den Ausgangszustand der Platte und Fig. 3 den Zustand nach Cominütiger gleichzeitiger Politur und Kupferabscheidung wieder. Zum Vergleich ist in Fig. 4 das Oberflächenprofildiagramm einer Kupferplatte aufgezeigt, die 10 min lediglich mit Aluminiumoxid einer Korngröße <0,5 um unter gleichen Bedingungen poliert wurde. Die Rauhigkeit dieser Oberfläche liegt günstigenfalls bei 0,04 - 0,05 /um.

Beispiel 2

Eine Kontaktfeder aus Kupfer-Berylium soll zur Verbesserung der Kontaktgabe einseitig optimal poliert und zum Korrosionsschutz vergoldet werden. Dazu wird die Feder mit Hilfe einer geeigneten Halterung auf den mit einem Wolltuch bespannten rotierenden Polierteller aufgepreßt. Die Feder wird als Kathode geschaltet, der Polierteller aus Edelstahl

als Anode. Als Elektrolyt dient ein saures handelsübliches Goldbad, dem im Gewichtsverhältnis 30: 1 feinkörniges Aluminiumoxid als Poliersubstanz zugesetzt wird. Die kathodische Stromdichte beträgt während der "Abscheidungspolitur" 2 A/dm². Die Dauer des Polier- und Abscheidungsvorgangs beträgt 6 min. Während dieser Zeit wird die Oberfläche der Feder auf eine Endrauhigkeit von (0,03 /um poliert und mit einer ca. 2 /um dicken Goldschicht überzogen. Die Ausgangsrauhigkeit der Feder lag bei 0,1 /um.

Patentansprüche

- oberflächen oxtrem geringer Rauhtiefe, dadurch gekennzeichnet, daß gleichzeitig mit einem mechanischen Poliervorgang
 auf den Werkstückoberflächen Metall abgeschieden wird.
 - 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Metall mittels eines stromlos arbeitenden Bades abgeschieden wird.
 - 3. Verfahren nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, daß das Metall mittels eines elektrolytischen Bades abgeschieden wird.
 - 4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Bad ein Poliermittel enthält.
 - 5. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß vor oder während der stromlosen Metallabscheidung eine Ka-talysatorlösung auf die Werkstückoberflächen aufgebracht wird, vorzugsweise eine solche, die ein Poliermittel enthält.

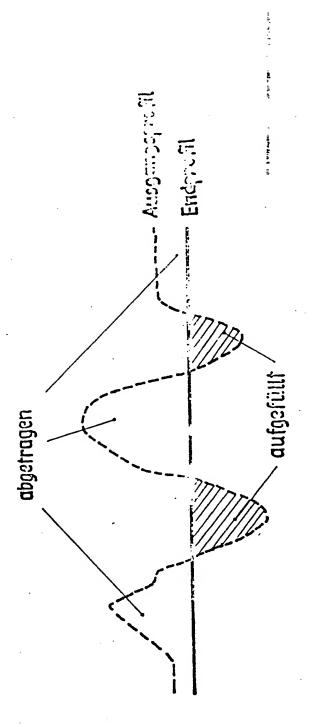
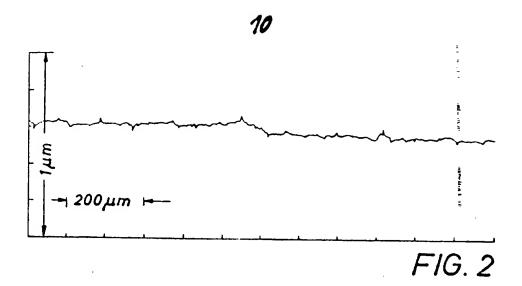
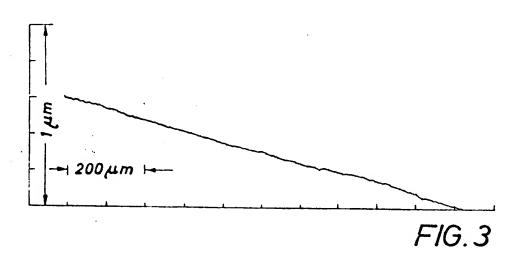
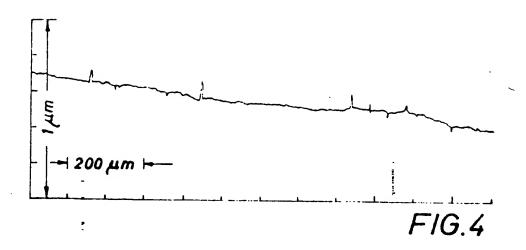


Fig. 1







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

